シリコン材料の科学と技術フォーラム 2003
2003 年 11 月 25 日（火）～　27 日（木）
湘南国際村センター

http://www.jatis.jp/siliconforumhp/silicontop.html

主催：シリコン材料の科学と技術フォーラム実行委員会
共催：日本学術振興会 結晶加工と評価技術第１４５委員会
協賛：（社）応用物理学会

実行委員長：　東北大学名誉教授　角野 浩二
実行委員　：　富士通研究所　金田 寛（プログラム委員長）

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ	小野 春彦	東北大学	末澤 正志
日立製作所	村上 進	宇宙科学研究所	田島 道夫
ルネサステクノロジ	服部 信美	岡山大学	上浦 洋一
三菱住友シリコン	島貫 康	大阪府立大学	井上 直久
岡山県立大学	末岡 浩治	大阪大学	吉田 博
ワッカーＮＳＣＥ	中居 克彦	九州大学	中島 寛
コマツ電子金属	中村 浩三	東芝セラミックス	鹿島 一日児

アシスタント：富士通研究所　高橋 英樹，棚橋 克人

場 所：湘南国際村センター国際会議場（**http://www.shonan-village.co.jp**）

期 日：平成 15 年 11 月 25 日（火）午前 11:00 (受付け開始)～ 27 日（木）午後 4：00

目 的：１．将来のデバイスに見合った高品質新機能シリコン材料の製造及び処理技術を効率的に開発のための基礎研究と応用研究の交流.
２．当面する問題をブレークスルーするための全員参加の討論.
３．シリコン材料技術が基盤とする種々の学問にかかわる研究者，技術者の再教育.

趣旨：前３回フォーラムに引き続き，上記の目的を持ったフォーラムを開催します．皆様の積極的なご参加をお待ちします．フォーラムは招待講演を基軸としますが，ポスター発表の論文も募集します．ポスターセッションとそれに先立つショート・プレゼンテーションのために，充分な時間を取ってあります．また，フォーラム開催期間を通じて充分自由討論を楽しむことができるように，時間的ならびに場所的なアレンジがされています．発表論文はすべてプロシーディングスに掲載されます．発表を希望される方は下記の要領で論文原稿をお送りください.

論文の原稿規定：　A4 版上質紙を用いたカメラレディ，英語，ページ数制限なし，書式自由の原稿２部を **１０月１０日必着**で，下記の参加申し込み先へお送りください.

参加費（１人当り）　タイプ A：　**38,000** 円：シングルルームを１人で使用
（消費税含む）　タイプ B：　**35,000** 円：ツインルームを 2 人で使用
タイプ C：　**31,000** 円：トリプルルームを 3 人で使用

上記 A,B,C のどのタイプの部屋も，バス，トイレ，ケーブル TV 付きです．また，A,B,C のどのタイプの参加費にも，（１）フォーラム登録費（11,000 円：A,B,C 共通），（２）２泊分宿泊費，（３）25 日夕食から 27 日昼食（但し，25 日夕食はバンケット）までの食費，ならびに（４）プロシィーディングス代が含まれています．タイプ B と C を希望の場合には，それぞれ，同室を希望する２人あるいは３人でまとめて申し込んでいただければ，そのように部屋割りします．そうでない場合には，委員会の方で適当に部屋割りを致します.

参加申込み方法：①．別紙「シリコン材料の科学と技術フォーラム 2003 参加申込み書」または
②．ホームページよりお申込み下さい

申込み先：**〒293-8511 千葉県富津市新富 20-1　新日本製鐵（株）技術開発本部　TIC 内**
㈱日鉄技術情報センター富津支所
シリコン材料の科学と技術フォーラム 2003 事務局　田村紀光

TEL : 0439-80-2073,　FAX : 0439-80-2738,　E-mail : t-tamura@re.nsc.co.jp
Web : http://www.jatis.jp

申込み締切り　：**10 月 31 日**　：但し，定員（８０名）になりしだい締切ります.

問合せ先：　富士通研究所　金田 寛
E-mail：kaneta.hiroshi@jp.fujitsu.com,　TEL：046-250-8266,　FAX：046-250-8178